

## ⑫ 公開特許公報(A)

昭61-173445

⑤ Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和61年(1986)8月5日

H 01 J 37/317

7129-5C

37/20

7129-5C

H 01 L 21/265

6603-5F

審査請求 有 発明の数 2 (全9頁)

⑭ 発明の名称 イオン注入装置のウェハ搬送装置

⑯ 特 願 昭60-14043

⑰ 出 願 昭60(1985)1月28日

⑱ 発 明 者 今 橋 一 成 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株式会社内

⑲ 出 願 人 東京エレクトロン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 森崎 俊明

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

イオン注入装置のウェハ搬送装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 真空処理室においてウェハにイオンを注入する装置に関し、第1及び第2予備真空室と、前記真空処理室の第1所定位置と前記第1予備真空室との間でウェハの移動に関与する第1ウェハ移動手段と、前記真空処理室の第2所定位置と前記第2予備真空室との間でウェハの移動に関与する第2ウェハ移動手段と、前記真空処理室の内部においてウェハを挟持して搬送するウェハ挟持搬送手段とを有し、該ウェハ挟持搬送手段は、前記第1所定位置とイオン注入部の間、及び該イオン注入部と前記第2所定位置の間とで、ウェハを挟持して搬送するイオン注入装置のウェハ搬送装置。

(2) 前記ウェハ挟持搬送手段は、第1及び第2の腕を有する第1挟持部材と、第3及び第4の腕を有する第2挟持部材とを具え、前記第1及び第

2挟持部材は夫々同期して動作する2個の駆動手段により駆動される特許請求の範囲第1項記載のイオン注入装置のウェハ搬送装置。

(3) 前記第1ウェハ移動手段は、前記第1予備真空室と前記真空処理室との間の真空ゲートを兼ね、前記第2ウェハ移動手段は、前記第2予備真空室と前記真空処理室との間の真空ゲートを兼ねる特許請求の範囲第1項記載のイオン注入装置のウェハ搬送装置。

(4) 複数のウェハを収納したウェハ・カセットから順次ウェハを取り出し、真空処理室においてウェハにイオンを注入し、イオン注入済のウェハを順次前記ウェハ・カセットに収納する装置に関し、(a) 夫々ウェハ・カセットを載置する少なくとも2個のウェハ・カセット載置部と、(b) 回転可能で且つ進退自在のウェハ保持部を有し、回転及び進退運動によりウェハの授受を行なう第1及び第2ウェハ転送手段と、(c) 回転部を有し、該第1又は第2ウェハ転送手段から受けたウェハの位置を調整するウェハ・アライメント手段と、

(d) 前記第1及び第2ウエハ搬送手段と夫々ウエハの授受を行なう第1及び第2の予備真空室と、  
 (e) 前記真空処理室の第1所定位置と前記第1予備真空室との間のウエハの移動に關与する第1のウエハ移動手段と、(f) 前記真空処理室の第2所定位置と前記第2の予備真空室との間のウエハの移動に關与する第2のウエハ移動手段と、(g) 前記真空処理室の内部においてウエハを挟持して搬送するウエハ挟持搬送手段とを具え、

前記第1ウエハ搬送手段は、前記少なくとも2個のウエハ・カセット載置部の一方に設けたウエハ・カセットと、前記第1予備真空室と、前記ウエハ・アライメント手段とでウエハ授受が可能であり、前記第2ウエハ搬送手段は、前記少なくとも2個のウエハ・カセット載置部の他方に設けたウエハ・カセットと、前記第2予備真空室と、前記ウエハ・アライメント手段とでウエハ授受が可能であり、前記ウエハ挟持搬送手段は、前記第1所定位置とイオン注入部の間、及び該イオン注入部と前記第2所定位置の間とで、ウエハを挟持し

装置に關する。

#### 〔従来技術とその問題点〕

イオン注入装置には、周知の如く、ウエハを大気中から予備真空室を介して真空処理室に搬入し、イオン注入後にウエハを再び予備真空室を介して大気中に搬出するウエハ搬送装置が設けられている。

この種のウエハ搬送装置として、従来から、ウエハの目重を利用する装置が知られている。この従来装置は、大気中から予備真空室を介して真空処理室に至るウエハの傾斜案内手段と、更にこの真空処理室から別の予備真空室を介して大気中に至る別の傾斜案内手段とを有し、ウエハの目重を利用し、ウエハを前記傾斜案内手段を用いて順次下方に移動させ、イオン注入処理を行なうものである。

上述の従来例は、ウエハ搬送用の駆動装置が不要という利点を有するが、次の如き問題がある。即ち、ホトレジスト層を設けたウエハの場合には、(a) 搬送途中でひつかかりを生じて作業の一

で搬送するイオン注入装置のウエハ搬送装置。

(5) 前記少なくとも2個のウエハ・カセット載置部の夫々は、昇降可能である特許請求の範囲第4項記載のイオン注入装置のウエハ搬送装置。

(6) 前記ウエハ挟持搬送手段は、第1及び第2の腕を有する第1挟持部材と、第3及び第4の腕を有する第2挟持部材とを具え、前記第1及び第2挟持部材は夫々同期して動作する2個の駆動手段により駆動される特許請求の範囲第4項記載のイオン注入装置のウエハ搬送装置。

(7) 前記第1ウエハ移動手段は、前記第1予備真空室と前記真空処理室との間の真空ゲートを兼ね、前記第2ウエハ移動手段は、前記第2予備真空室と前記真空処理室との間の真空ゲートを兼ねる特許請求の範囲第4項記載のイオン注入装置のウエハ搬送装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

##### 〔技術分野〕

本発明は、イオン注入装置の真空処理室においてウエハにイオン注入を行なうためのウエハ搬送

時中断を招いたり、(b) ストップによりウエハを停止させる際、ウエハ端部に付着したレジスト層及びウエハ端部自体が破壊して所謂パーティクル(塵)発生の原因となっていた。更に、ウエハにホトレジスト層を設けない場合であつても、上記(a)の問題を完全に除去できず、更に上記(b)と同様にウエハ端部自体の損傷によるパーティクル発生が問題となっていた。

更に、従来の装置は、ウエハ・カセットから順次イオン注入部に搬入されたウエハは、イオン注入後、別のウエハ・カセットに収納されるため、ウエハ管理、即ち、生産管理上種々の不都合があつた。

##### 〔発明の目的〕

本出願に係る発明の目的は、上述の従来例の欠点を除去したイオン注入装置のウエハ搬送装置を提供することである。

本出願に係る第1発明は、予備真空室から真空処理室に搬入されたウエハを、同期して動作する2個の駆動手段を用いて挟持搬送することによ

り、上述の目的を達成するイオン注入装置のウエハ搬送装置に関する。

更に、本出願に係る第2の発明は、上述の第1発明の特徴の外に、新規なウエハ搬送システムにより、ウエハ・カセットから順次取り出したウエハを、イオン注入後、同一のウエハ・カセットに収納すると共に、塵発生が極めて少ないイオン注入装置のウエハ搬送装置に関する。

#### [発明の概要]

本願発明は、真空処理室においてウエハにイオンを注入する装置に関し、第1及び第2予備真空室と、前記真空処理室の第1所定位置と前記第1予備真空室との間でウエハの移動に関与する第1ウエハ移動手段と、前記真空処理室の第2所定位置と前記第2予備真空室との間でウエハの移動に関与する第2ウエハ移動手段と、前記真空処理室の内部においてウエハを挟持して搬送するウエハ挟持搬送手段とを有し、該ウエハ挟持搬送手段は、前記第1所定位置とイオン注入部の間、及び該イオン注入部と前記第2所定位置の間とで、ウ

段と、(g)前記真空処理室の内部においてウエハを挟持して搬送するウエハ挟持搬送手段とを具え、

前記第1ウエハ転送手段は、前記少なくとも2個のウエハ・カセット載置部の一方に設けたウエハ・カセットと、前記第1予備真空室と、前記ウエハ・アライメント手段とでウエハ授受が可能であり、前記第2ウエハ転送手段は、前記少なくとも2個のウエハ・カセット載置部の他方に設けたウエハ・カセットと、前記第2予備真空室と、前記ウエハ・アライメント手段とでウエハ授受が可能であり、前記ウエハ挟持搬送手段は、前記第1所定位置とイオン注入部の間、及び該イオン注入部と前記第2所定位置の間とで、ウエハを挟持して搬送するイオン注入装置のウエハ搬送装置に関する。

#### [実施例]

以下、添付の第1図乃至第4図を参照して本願発明の実施例を説明する。尚、図面中、対応する個所には同一の参照番号を付してある。

エハを挟持して搬送するイオン注入装置のウエハ搬送装置に関する。

更に、本願発明は、複数のウエハを収納したウエハ・カセットから順次ウエハを取り出し、真空処理室においてウエハにイオンを注入し、イオン注入済のウエハを順次前記ウエハ・カセットに収納する装置に関し、(a)夫々ウエハ・カセットを載置する少なくとも2個のウエハ・カセット載置部と、(b)回転可能で且つ進退自在のウエハ保持部を有し、回転及び進退運動によりウエハの授受を行なう第1及び第2ウエハ転送手段と、(c)回転部を有し、該第1又は第2ウエハ転送手段から受けたウエハの位置を調整するウエハ・アライメント手段と、(d)前記第1及び第2ウエハ転送手段と夫々ウエハの授受を行なう第1及び第2の予備真空室と、(e)前記真空処理室の第1所定位置と前記第1予備真空室との間のウエハの移動に関与する第1のウエハ移動手段と、(f)前記真空処理室の第2所定位置と前記第2の予備真空室との間のウエハの移動に関与する第2のウエハ移動手

第1図は、真空処理室及び予備真空室の外部でのウエハ搬送を説明するための概略斜視図である。尚、第1図において、Wはウエハを示す。

第1図に示す装置は、ウエハ・カセット載置台10及び12、昇降装置を内部に有する昇降装置部14及び16、ウエハ転送手段18及び20、ウエハ・アライメント手段22、予備真空室24及び26、内部に真空処理室等を有するチャンバ28等から成る。

ウエハ・カセット載置台10には、ウエハ・カセット11が置かれ、このカセットの内部には、複数枚のウエハが収納されている。昇降装置部14に設けた昇降装置は、ウエハ・カセット載置台10を昇降(即ち、ウエハ・カセット11を昇降)させるためのものであり、この昇降装置及びウエハ転送手段18により、所定の位置からウエハを取り出し、或いはイオン注入済のウエハを所定位置に収納する。

尚、ウエハ・カセット載置台12にも、ウエハ・カセット(図示せず)が置かれ、このウエハ・

カセットの内部にも複数枚のウエハが収納されている。上述の場合と同様に、ウエハ・カセット載置台12は、昇降装置部16の内部に設けた昇降装置により昇降する。この昇降装置及びウエハ転送手段20により、ウエハ・カセットの所定の位置からウエハを取り出し、或いはイオン注入済のウエハをカセットの所定位置に収納する。

ウエハ転送手段18は、回転可能で且つ進退自在のウエハ保持部40を有し、ウエハ・カセット11との間でウエハの授受（即ち、カセットからのウエハの取出し及びカセットへのウエハの収納）を行なう。例えば、ウエハ・カセット11からウエハを取り出す場合には、ウエハ保持部40を回転させて一方の端部をウエハ・カセット11の方向に向けた後、ウエハ保持部40をウエハ・カセット11の方向に延ばす（或いは、ウエハ保持部40を、回転と同時に前進させてもよい）。

尚、ウエハ・カセット11の内部のウエハを、ウエハ保持部40に載せる際、昇降装置或いはウ

ェハ転送手段22及び予備真空室24との間でもウエハの授受を行ない、一方、ウエハ保持部42も、同様に、ウエハ・カセット載置台12に設けたウエハ・カセット（図示せず）とのウエハの授受の外に、ウエハ・アライメント手段22及び他の予備真空室26との間でもウエハの授受を行なう。

ウエハ・アライメント手段22は、ウエハ転送手段18又は20から受けたウエハのエッジを検出して、ウエハを所定位置とする手段であり、回転可能なウエハ載置台（ウエハの下にある）、及びエッジ検出手段44（例えば、ホトセンサ対）を有する。ウエハ・アライメント手段22において位置決めされたウエハは、ウエハ保持部40又は42により、次のステップに移される。

尚、第1図において、予備真空室24は、外部（アウター）ゲート30により大気雰囲気と気密状態が維持され、一方、他の予備真空室26は、外部ゲート32により大気雰囲気と気密状態が維持される。第1図の参照番号33及び34は、夫

々ウエハ保持部40の動作を次のようにすることが必要である。即ち、ウエハ保持部40の先端部がウエハ・カセット11の内部に延びる際、ウエハ保持部40の上面を所望のウエハの下面より低くし、ウエハ保持部40が所定位置（ウエハを載せる位置）にくると、昇降装置によりウエハ・カセット11を僅か下げるか、或いは、ウエハ保持部40を僅か上げるようにする。後者の場合、即ち、ウエハ保持部40を僅か上げる場合には、当然のことながら、ウエハ転送手段18に適当な昇降手段を設ける必要がある。上述の説明はウエハ・カセット11からウエハを取り出す動作であるが、逆の操作、即ち、ウエハ・カセット11にウエハを収納する場合には、逆の動作が必要である。

尚、ウエハ・カセット載置台12に設けたウエハ・カセットと、ウエハ転送手段20（ウエハ保持部42を有する）とのウエハの授受は、上述の場合と同様なので、説明を省略する。

ウエハ保持部40は、上述のウエハ・カセット11とのウエハの授受の外に、ウエハ・アライメ

ンツ予備真空室24及び26内部を予備真空引きする際に使用するバルブ等を収納する匣体であり、参照番号35及び36は、夫々、予備真空室24及び26の上部に設けたのぞき窓（例えばガラス製）である。尚、参照番号46及び47は夫々ウエハ保持部材40及び42の前進・後退用の駆動装置であり、48及び49は塵よけ用のカバーである。このカバーの上面はウエハ保持部材40及び42の上面より低くなっている。

以下、第1図を参照して、真空処理室及び予備真空室の外部（即ち、大気雰囲気中）でのウエハ搬送の一例を説明する。

先ず、ウエハ・カセット11内のウエハは、総てイオン注入前のウエハとする。昇降装置部14内の昇降装置は、ウエハ・カセット載置台10を上下方向に移動させ、所望のウエハがウエハ転送手段18により搬出される位置とする。次に、ウエハ保持部材40が回転して前進（或いは回転且つ前進）し、ウエハ・カセット11内の所望のウエハを取り出す。尚、ウエハ保持部材40は、回

転する際、回転に支障のない位置になければならないことは勿論である。次いで、ウエハ保持部材40は、後退してウエハ・アライメント手段22の方向に回転し、再び前進してウエハ・アライメント手段22にウエハを渡す。その後、ウエハ保持部材40は、ウエハ・カセット11から次のウエハを取り出す動作に移る。

ウエハ・アライメント手段22は、回転可能のウエハ載置台及びウエハ・エッジ検知手段44により、ウエハのエッジを検出し、ウエハを所定位置とする。次に、別のウエハ転送手段20は、位置決めされたウエハをウエハ・アライメント手段22から受け取り、回転及び前進運動により、ウエハを、外部ゲート32を介して、予備真空室26に搬入する。

予備真空室26に搬入されたウエハは、後述するウエハ搬送によりイオンが注入され、別の予備真空室24から、外部ゲート30を介して、ウエハ転送手段18により搬出される。ウエハ転送手段18により搬出されたウエハは、既に説明した

ト載置台12に設けたカセット（図示せず）内のウエハを、上述したと同様に処理する。この間に、ウエハ・カセット載置台10に、新たなウエハ・カセットを設置するようにすれば、イオン注入作業を円滑にすることができる。尚、ウエハ・カセット載置台12に設けたカセットのウエハを処理する場合には、ウエハ転送手段20が、上述したウエハ転送手段18と同様の動作をすることは勿論である。

第2図は真空処理室50（チャンバ28（第1図）の内部に存在する）でのウエハ搬送を説明するための概略平面図であり、第3図は予備真空室24、26及び真空処理室50でのウエハ搬送を説明するための概略断面図である。一方、第4図は第3図の2個のウエハ移動手段が共に上方に移動した様子を示す概略断面図である。

第2図及び第3図において、ウエハ挟持搬送手段52は、左側方向（図面上）方向からウエハを保持する挟持部材52Aと、右側方向（図面上）方向からウエハを保持する挟持部材52Bとを有

昇降装置の上下位置制御等により、ウエハ・カセット11内部の所定位置（例えば元の位置）に収納される。

上述したように、ウエハ転送手段18は、イオン注入前のウエハをカセット11からウエハ・アライメント手段22に転送すると共に、イオン注入済のウエハを予備真空室24からカセット11に搬入する機能を有する。この2つの動作を効率良く行なうためには、例えば、イオン注入前のウエハをウエハ・アライメント手段22に渡した後、ウエハ・カセット11に向う途中で、予備真空室24からウエハを搬出してウエハ・カセット11に収納した後、カセット11から次のウエハを取り出してウエハ・アライメント手段22に渡し、以後この動作を繰り返せばよい。このように、ウエハ・カセット11内のウエハを順次搬入し、イオン注入後、再びカセット11に収納する。

カセット11内部の全部のウエハに対してイオン注入を完了したら、次に、別のウエハ・カセッ

する。図示の如く、挟持部材52Aは2本の腕52A-1及び52A-2を有し、一方、他の挟持部材52Bも2本の腕52B-1及び52B-2を有する。挟持部材52A及び52Bは、夫々、同期して動作する駆動手段54及56（第3図）、例えば、ステッピング・モータ或いはブラシレスDC（直流）モータ等、によりベルト等（図示せず）を介して駆動される。腕52A-1、52A-2、52B-1及び52B-2は、夫々、第3図に示すように、略L字型の断面を呈している。したがって、これらの腕は、ウエハを挟持すると共にウエハを保持している。尚、これらの腕の動きを適当に制御すれば、ウエハを挟持せず、単に保持するようにすることも可能である。

ウエハ挟持搬送手段により、例えば、第2図の右側のウエハW1を中央のイオン注入部に移送すると共に、中央のウエハW2を左側に位置に移送する場合には、第2図に示した挟持部材52A及び52Bは、夫々、左及び右方向に僅かだけ移動

してウエハW1及びW2を挟持する。次に、挟持部材52A及び52Bは、左方向に移動し、夫々、右及び左方向に僅かだけ移動して挟持していたウエハW1及びW2を開放する。このときの52A-1及び52B-1の位置を破線で示す。逆の場合（左及び中央位置にあるウエハを夫々中央及び右側位置に移送する場合）も、上述の説明から容易に理解される。尚、挟持部材52A及び52Bは、ウエハは搬送する際、僅かだけ上方に移動した後、平行移動する。このように、ウエハ挟持搬送手段52は、丁度シャトルの如き運動をする。

ウエハW1は、第3図に示すように、ウエハ寸法に応じて交換可能のウエハ・プラテン60上に設置され、このプラテン60は、予備真空室26と真空処理室50との間の気密保持を目的とする（第4図参照）内部（インナー）ゲート62の上に設けられている。内部ゲート62は適当な昇降手段（油圧或いは空気圧装置）64及び制御手段（図示せず）により昇降が制御される。上述の内

内を循環する。ウエハ押え84は、軸93を介して駆動装置94により制御され、軸86を中心として回動して開閉される。番号96は、イオンの飛来方向を示す。

第4図は、第3図のウエハ移動手段65及び75を上方に移動させ、夫々、予備真空室26及び24と、真空処理室50とを気密状態にした様子を示す図であり、各構成要素は第3図に関連して既に説明したので、第4図の説明は省略する。

次に、第2図乃至第4図を参照して、予備真空室24及び26、真空処理室50でのウエハ搬送の一例を説明する。尚、以下の説明におけるウエハ搬送は単なる例示であり、本発明はこれに限定されるものではない。

説明を判りやすくするため、ウエハ・カセット11（第1図）から第1枚目のウエハが、ウエハ転送手段18及びウエハ・アライメント手段22を介して、ウエハ転送手段20（第1図）により、予備真空室26に搬入されたとする。尚、外部ゲート32及び30は同期して動作し、ウエハ

部ゲート62及び昇降手段64等は、ウエハ移動手段65を構成する。更に、第3図の左側には、上述の構成と同様に、ウエハの寸法に応じて交換可能のウエハ・プラテン70、予備真空室24と真空処理室50との間の気密保持を目的とする内部ゲート72、この内部ゲート72を上下に移動させる昇降手段（油圧或いは空気圧装置）74が設けられている。内部ゲート72及び昇降手段74等は、ウエハ移動手段75を構成する。

第2図及び第3図のイオン注入部58には、ウエハを直接搬送し且つウエハの寸法に応じて交換可能のウエハ・プラテン80、このプラテン80を支持するプラテン82、ウエハ押え84、プラテン82を回動させてウエハをイオン注入位置又は挟持搬送位置とする際の軸86等がある。軸86は、磁気シールドベアリング88等を介して装置の外部に設けた駆動手段90により駆動される。プラテン82の内部にはイオン注入によつて発生する熱を吸収する冷媒が循環するようになっており、冷媒はパイプ92を介してプラテン82

移動手段65及び75も同期して動作するのが望ましいが、絶対的なものではない。第1枚目のウエハを、予備真空室26に搬入する際には、ウエハ移動手段65及び75は、第4図の状態となっている。尚、外部ゲート32（及び30）を開く際には、予備真空室26（及び24）内に例えばチツソガスを封入し、予備真空室内を略大気圧とすることは、従来例と同様である。予備真空室26にウエハが収納されると、外部ゲート32を開じ、予備真空室26（及び24）内部を所定値（例えば $10^{-2}$ Torr）まで予備真空引きする。

その後、ウエハ移動手段65及び75を第3図に示す所定位置まで下げる。尚、真空処理室50は常時真空引きされ所定値（例えば $10^{-6}$ Torr）に維持されるようになっている。次に、第1枚目のウエハを、第2図に示すウエハ挟持手段52により中央のイオン注入部58に移送し、ウエハ挟持搬送手段52を第2図の位置に戻す。次に、ウエハ移動手段65を第4図に示す位置に戻し、外部ゲート32を開いて第2枚目のウエハを

受け入れ、予備真空室26の内部を予備真空引きする。

尚、ウエハ挟持搬送手段52によりウエハをイオン注入部に移送する前に、ウエハ押え84は開いた状態になつている。ウエハがウエハ・プラテン80に載置されると、ウエハ押え84を閉じてウエハを押え、プラテン駆動装置90により、ウエハをイオン注入位置とした後イオン注入処理を行なう。イオン注入後、再びプラテン駆動装置90を動作させて、プラテン82を第3図に示す位置とし、ウエハ押え84を開放する。

この間(例えば、イオン注入直後)に、第2枚目のウエハを載置したウエハ移動手段65を下げ、第3図に示す位置とし、ウエハ挟持搬送手段52により、第1枚目のウエハ(イオン注入済)及び第2枚目のウエハを、夫々、ウエハ・プラテン70及び80上に移動させる。この直後に、ウエハ挟持搬送手段を第2図に示す位置とした後、ウエハ移動手段65及び75を上昇させる。

第2枚目のウエハにイオン注入を行なつている

ハ・カセットを配置することも可能である。

#### [発明の効果]

以上、説明したように、本出願に係る発明によれば、一方の予備真空室から真空処理室に搬入されたウエハを、イオン注入後、他方の予備真空室に搬出するために、同期して動作する2個の駆動手段を用いてウエハを挟持搬送することにより、塵の発生の極めて少ないイオン注入装置のウエハ搬送装置を実現できる。

更に、本出願に係る発明によれば、ウエハ・カセットから順次取り出したウエハを、イオン注入後、同一のウエハ・カセットに収納することができるので、ウエハ管理面の効果が大きい。

更に、イオン注入処理は短時間で終了するので、上述したように、4個のウエハ・カセットを設けることはイオン注入作業において非常に効果的である。特に、本発明に係る装置によれば、カセットから搬出したウエハを、イオン注入後、同一のカセットに収納できることを考慮すると、上述の4個のウエハ・カセットを設けることは、生

間に、予備真空室26には第3枚目のウエハが搬入され、一方、他の予備真空室24からは第1枚目のウエハが搬出される。尚、外部ゲート30及び32を開く場合、予備真空室に、例えば、チツソガス等を注入することは上述した。

その後(例えば第2枚目のウエハへのイオン注入直後)、ウエハ移動手段65及び75を所定位置まで下げ、ウエハ挟持搬送手段52により、第3枚目のウエハを真空処理室50に(ウエハ・プラテン80の上に)移送すると共に、第2枚目のウエハを左側のウエハ・プラテン70上に移す。以後のウエハの動きは、上述の場合から明らかである。

#### [変更・変形例]

上述の説明では、2個のウエハ・カセットは、第1図に示すように、装置の夫々の端部に設けられている。しかし、これに限らず、装置の手前に設けるようにしてもよい。更に、第1図に示す2個のカセット昇降装置の外に、装置の手前に新たなカセット昇降装置を2個設け、合計4個のウエ

産効率の観点から極めて有効といえる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は真空処理室及び予備真空室の外部でのウエハ搬送を説明するための概略斜視図、第2図は真空処理室の内部でのウエハ搬送を説明するための概略平面図、第3図は予備真空室及び真空処理室でのウエハ搬送を説明するための概略断面図、第4図は第3図の2個のウエハ移動手段が共に上方に移動した様子を示す概略断面図である。

10、12：ウエハ・カセット載置台

11：ウエハ・カセット

18、20：ウエハ転送装置

22：ウエハ・アライメント手段

24、26：予備真空室

40、42：ウエハ保持部材

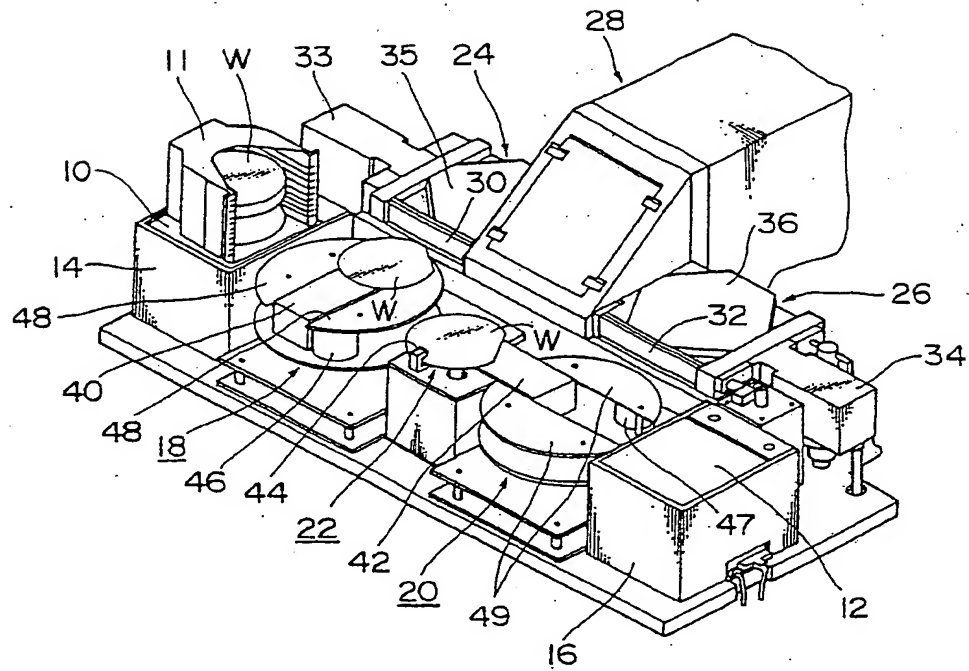
50：真空処理室

52：ウエハ挟持搬送手段

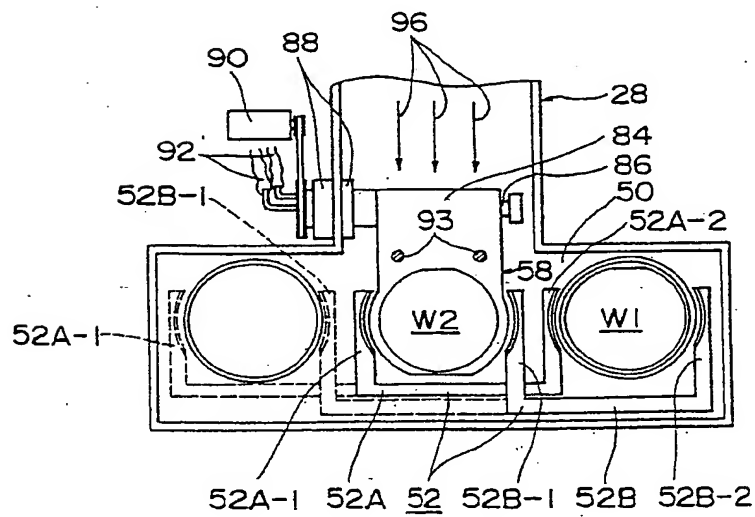
60、70、80：ウエハ・プラテン

65、75：ウエハ移動手段

第 1 圖

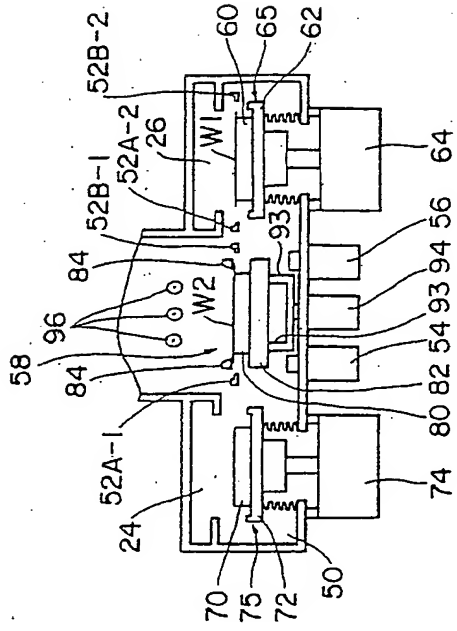


第 2 図





第 3 図



第 4 図

